

70nm以下のボイドフリーなCu埋め込みに画期的なソリューションを提供

微細なホール内に緻密な連続薄膜堆積

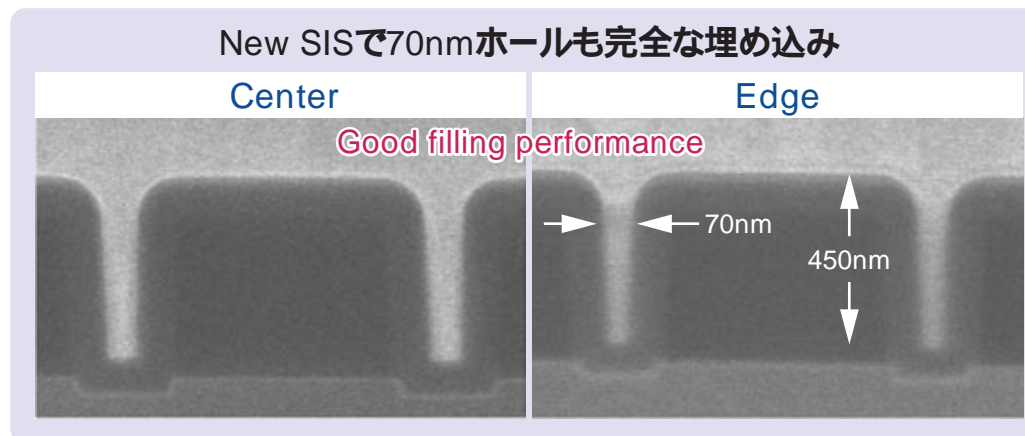
ホール内のサイドウォール/ボトムへの十分な薄膜堆積

ホール内上部の 過剰堆積を排除



ULVAC Solutionsが応えます

PVD: アルバック独自のLTS
(Long Throw Sputtering)の発展
SIS(Self-Ionized Sputtering)
New SIS(2002年発表)



CVD: WN-CVD、New Metal CVD(2003年以降発表予定)

Systems

Spin Coater

SOD SYSTEM

株式会社アルバック



Annealing



Vertical
Furnace
V-Series

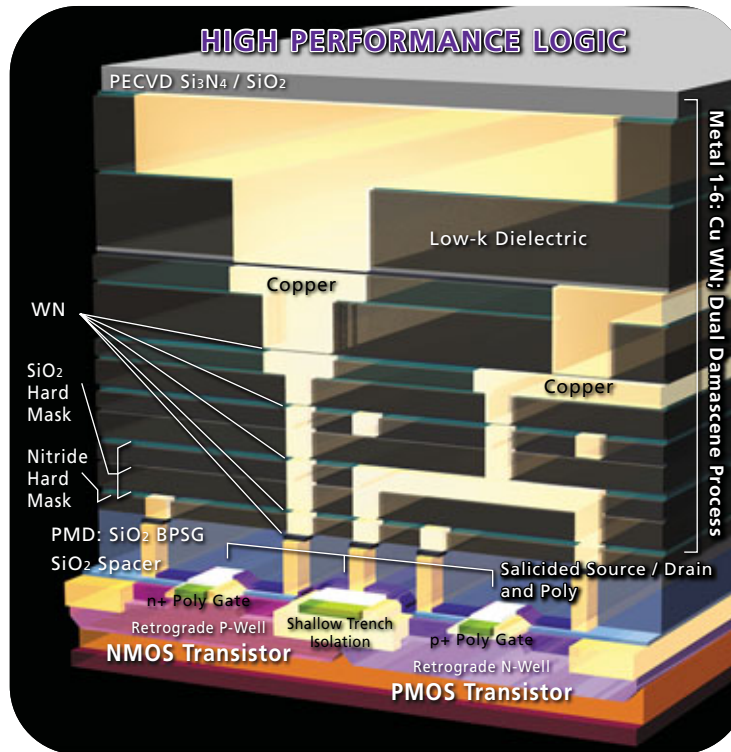
株式会社アルバック

Ion Implanter



IW-630

株式会社アルバック



Sputtering



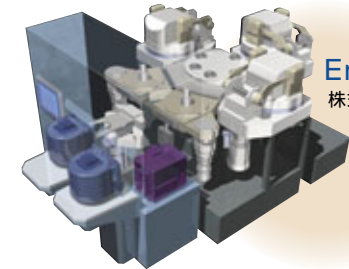
Entron
株式会社アルバック



CERAUS
Zi-1000

株式会社アルバック

Etching



Entron NLD
株式会社アルバック

Resist Stripping



enviro™
株式会社アルバック

Compact Annealing



RTA-8000

アルバック理工株式会社

Components

Analyzer / Measurement



PHI Quantera SXM
PHI 700
アルバック・ファイ株式会社



GI-M2
株式会社アルバック



REPROS
株式会社アルバック

MESEC
株式会社アルバック



HELIOT
株式会社アルバック



Vacuum Pump



LR/HR Series
株式会社アルバック



UTM-FW/FH Series
株式会社アルバック



CRYO-U 12H
アルバック・クライオ株式会社



VPT-030
アルバック機工株式会社

Material



Target
アルバックマテリアル株式会社